纳米压痕仪 **G200** 操作规程

1、开、关机程序：a)开机顺序：开启仪器总电源，再开计算机电源，机器预热至少30min。启动NanoSuite控制软件，调取相关的测试方法设置测试。 b)关机顺序：首先退出测试程序、关闭计算机、最后关掉仪器总电源。

2.打开NanoSuite软件后鼠标右击，选择Initialize；

3．安装样品，然后移动样品台，调节镜头相对于中间fused silicon的焦距，直至fused silicon成像清晰。再移动样品台来根据镜头与中间fused silicon 之间的焦距来调节待测样品同镜头之间的距离，直至样品成像清晰；

4.进行压头与镜头位置的修正。在镜头下右击选择Microscope to Indenter Calibration;

5.开始压痕实验。选择Batch Mode可进行批量实验，选择合适的测试方法。单击Define 选项卡以显示Define 页面。在屏幕的左边的向导会帮助您定义一个通用的批量实验，当你通过一步步设置实验时，在Next Step 按钮下面会出现相应的文本。在向导的帮助下选择适合的实验参数。 设置完一系列参数后，点击“the Define Array of Tests Beginning at this Location button”，出现对话框，可以在“Group”的下拉式菜单中选择预定义好的参数，也可以把光标移到“X-Direction”和“Y-Direction,”指定压痕/划痕数目；在“X-Direction”和“Y-Direction. ”中输入它们的间距，然后点OK按钮；压痕点间距或行间距应该大于等于最大压痕深度的20-30 倍。 点击Test 按钮显示 Test 页面；点击绿色箭头开始试验测试。